

特許情報検索の現状と課題

住友電工知財テクノセンター株式会社
日本知的財産協会 知的財産情報検索委員会委員長
臼井 裕一

PROFILE

住友電工入社後、研究開発部門にて研究開発に従事、その後研究開発部門テクノリサーチセンターに異動し、情報調査・管理業務。その後現職に。

✉ Usui-yuichi@sei.co.jp

☎ 045-853-7160

1 はじめに

知的財産権は重要な経営資源であり、事業戦略、研究開発戦略と連携した知財戦略を立案・推進するにあたって特許情報の果たす役割は、非常に大きい。

昨年もJAPIO 2007 YEAR BOOKに特許情報検索の現状と課題について述べさせて頂いたが、今回はその後の状況について述べる。

2 特許情報政策

2.1 昨年までの動向

「知的財産立国」を国家戦略として目指し、2002年7月に知的財産戦略会議において「知的財産戦略大綱」が取りまとめられ、ついで11月に「知的財産基本法」が制定され、翌2003年に内閣に「知的財産戦略本部」が設置され、「知的財産立国」を推進する体制が整った。「知的財産戦略本部」は2003年から毎年、数百項目の施策からなる知的財産推進計画を制定している。この推進計画は、具体的目標と達成時期が明示されている点で、非常に重要であり、かつ影響度の大きいものである。また、特許法改正により2001年10月以降の出願について審査請求可能期間が7年から3年に短縮され、それに伴って審査請求件数が急増し、審査順番待ち期間も長期

化が避けられない状況となった。このため知的財産推進計画2004において、2004年現在で26ヶ月ある審査順番待ち期間を最終的には0とすることを目指し、中期目標としては順番待ち期間がピークを迎える5年後の2008年に20ヶ月台に留め、長期目標としては10年後の2013年に11ヶ月とした。この目標達成のために2004年からは、「特許審査迅速化・効率化の中・長期目標を達成するための実施計画」を知的財産推進計画の作成時期に合わせて策定し前年度の目標および達成状況とともに知的財産戦略本部に報告し、公表している。2005年12月には、この特許審査迅速化の目標達成を最重要課題として、特許庁を中心として経済産業省全省挙げての総合対策を実施するために、経済産業大臣を本部長とする「特許審査迅速化・効率化推進本部」が設置され、2006年1月に官民を挙げて取り組むべき「特許審査迅速化・効率化のための行動計画」が策定されている。一方、特許庁では、「知的創造サイクルの活性化（外部ユーザ利便性向上）」「世界最高レベルの迅速かつ的確な審査」「業務の根本的見直しとレガシーシステム脱却」の3点を目標に掲げて2005年8月に「特許庁業務・システム最適化計画（改訂版）」⁽¹⁾を策定した。この最適化計画はおおよそ10年の長期的スパンで取り組んでいるもので、その前半で新事務処理システムを構築し、後半にて検索システムを構築するというものである。前半の新事務処理システムの稼働は2011年1月、後半の検索システムの稼働は2014年1月を予定している。な

お、この計画において外部ユーザの利便性向上に関連する記述は以下の通り。

産業財産権情報の対外提供

- ・ 24時間、365日のインターネット出願
- ・ インタラクティブ申請の導入
- ・ インターネット公報の推進
- ・ データ提供のリアルタイム化
- ・ 包袋情報の無料提供の推進
- ・ 審査・審理関連情報の提供
- ・ 検索機能の提供の拡大
- ・ 快適なレスポンスの維持

2.2 その後の動向

昨年の執筆時以降の特許情報検索に関わる主なものは以下の通り。

- ・ 知的財産推進計画2008（2008年6月）
- ・ イノベーションと知財政策に関する研究会政策提言および報告書（2008年8月）
- ・ 特許庁業務・システム最適化計画（検索系システム追補版）（案）に対する意見募集（2008年8月）

2.2.1 知的財産推進計画2008⁽²⁾

知的財産戦略本部の設置から5年が経過し、2003年以来「世界最先端の知的財産立国」を目指し一定の成果をあげてきた訳であるが、世界的に見た場合遅れをとっている面もあることは否定できない状況である。2008年度においてはこの状況に鑑み、技術、制度、市場のグローバル化の中で知財戦略を国際的観点で捉えて、「世界を睨んだ知財戦略の強化」に取り組むとして知的財産推進計画2008が策定された。この推進計画で特許情報検索に関連するのは以下の通り。

- ・ 特許情報と学術情報を統合した検索システムの利便性を向上させる。
- ・ 先行技術文献の調査環境を充実する。
- ・ 特許電子図書館等を通じた産業財産権情報の利用環

境を整備する。

先行技術文献の調査環境の充実では、国内外の特許文献と非特許文献とをシームレスに検索できる環境を整備することと、韓国・中国の特許文献を審査用システムに蓄積するための取り組みを開始することの2点があげられている。これらは後に述べる特許庁業務・システム最適化計画（検索システム追補版）に関連する内容である。また、特許電子図書館等を通じた産業財産権情報の利用環境の整備では、引用文献情報の充実、および特許分類に慣れていない研究者が簡単に検索できるシステムの開発、および韓国・中国の特許情報を提供する準備をすすめることの3点があげられている。

2.2.2 イノベーションと知財政策に関する研究会政策提言および報告書⁽³⁾

我が国では、これまでプロパテント政策によりイノベーションの促進を図ってきたが、現在のように知的財産権制度を巡る環境が大きく変化している中で更なるイノベーションの進展を促すためには、この変化に対応してグローバルな視点での検討が必要となる。このために2007年12月に特許庁に「イノベーションと知財政策に関する研究会」が設置され、今後の我が国の知財政策のあり方について広く議論がなされた。検討内容に対する2回のパブリックコメントをも踏まえて2008年8月に政策提言および報告書として発表された。この政策提言は、以下の3つの観点から具体的に13個の提言がなされている。「Ⅰ．持続可能な世界特許システムの実現」、「Ⅱ．特許システムの不確実性の低減」、「Ⅲ．イノベーション促進のためのインフラ整備」がその観点である。ここではこれら提言について詳細な説明は行わないが、非常に重要な内容なので是非とも目を通していただきたい。ただし、これらの提言のうち提言10の「グローバルなイノベーションインフラとしてのシームレスな検索環境」については、特許情報検索に大いにかかわるため



若干の説明を加える。

この提言10は、具体的には特許庁の新検索システムの開発、すなわち特許庁業務・システム最適化計画の検索システムに関する提言となる。その概要としては、「特許庁新検索システムの開発に際して、大学・企業等のイノベーション促進にも資するように可能な限りオープンな形を採用し、特許情報とグローバルに存在している技術情報をシームレスに検索できる環境を整備することとなっている。更に具体的には、中国語・韓国語の特許文献や民間ではデータベース化されない技術情報の収集・蓄積を図るとか、概念検索、図形イメージ検索、翻訳辞書・シソーラス辞書等を開発し、外部ユーザと共有するとの記述もある。これらは次項で述べる特許庁業務・システム最適化計画（検索系システム追補版）（案）に組み込まれている。

2.2.3 特許庁業務・システム最適化計画（検索系システム追補版）（案）⁽⁴⁾

本原稿を執筆している時点で、ちょうど特許庁業務・システム最適化計画（検索系システム追補版）（案）に関してパブリックコメントが募集されている。案が提示され、ようやく最適化計画の後半である検索系システムがやや具体的に見えてきた。先に述べたように、ここでは先のイノベーションと知財政策に関する研究会の政策提言10をベースにして、国内外の特許文献と非特許文献がシームレスに一括検索できるものを目指している。その他で筆者の目を引いた内容としては、「審査ナレッジの共有と有効活用」および「分類・検索キーの高度利用」がある。通常サーチャーは、よく精通している主題の場合であれば検索式もすぐに思い浮かび、かつ何件くらいヒットするかも予測がつくものであるが、初めて検索する主題であって技術内容に精通していない場合には一定の手順で分類やキーワードを選定して検索することは出来てもなかなか結果に自信が持てない場合がある。

このよく精通した主題に関してはサーチャーとして検索ナレッジが身に付いているからであるとすれば、これを何らかの形で共有できればということ考えたこともあがるが、実現は困難であった。審査ナレッジを用いることによって、このようなことが実現できることを大いに期待している。また、「分類・検索キーの高度利用」ではFタームの変更履歴や付与根拠およびパラメータ範囲等の付加情報を追加してデータベース化し、分類付与時に利用できれば人による付与のばらつき等もある程度解消でき、分類付与精度があがることが期待できる。現在は分類の付与やメンテナンス、改正作業は紙ベースで行われていて、それ故に付与時の貴重なデータが後に生かすことができないと聞いている。これも是非とも実現して欲しい。いずれにしても最適化計画の検索システムが完成して、審査官と同等な検索機能が提供されるのは2014年の1月となる。その間に解決しなければならないことは、多岐に渡っている。くれぐれも効率よく開発を進め、また早め早めに情報を提供していただきたいものである。

3 特許情報検索に関して最近気になる点

3.1 分類に関する事項

昨年JAPIO 2007 YEAR BOOKに、IPC第8版（最近のリフォームIPCということでIPC-Rといわれるので以降はIPC-Rと記述する）について日本のデータベースではIPDLも含めて、改正時の既発行分の再分類データが収録されていないことを危惧している旨、記載した。この再分類データは改正IPC-Rが発効される前に、主として三極特許庁が手分けして再分類し、欧州特許庁（EPO）が管理しているMCD（Master Classification Database）に搭載される。その後に改正IPC-Rが発効されるため、このMCDデータを導入

していれば発効時点で改正IPC-Rにて過去分も含めて検索されることになる。ところで昨年時点では、日本のデータベースではこのMCDデータが収録されているものが無かったため、改正IPC-Rだけで検索すると過去分が漏れてしまうという現象が生じていた。ところで、この1年でこのMCDデータを搭載するデータベース業者が出てきた。またMCDデータを搭載する計画を明言するデータベース業者も複数出てきたため、遠からずこの危惧は解消するものと思われる。

ところで分類に関してはもう一点気になる問題がある。この問題に関しては勝手に「FIとIPCの乖離」という呼び方をしているがサーチャーにとっては大きな問題と考えている。少し細かい話になるが詳細に例をあげて説明したい。

図1はIPDLのPMGS（パテントマップガイダンス）のIPC第8版のG02B6/00（ライトガイド；ライトガイドおよびその他の光素子，例．カップリング，からなる装置の構造的細部 [4, 6]）の一部である。ここで6/245および6/25に注目願いたい。技術内容としては、ともに光ファイバの接続前の処理となる。6/245は被覆の除去、6/25は被覆除去後のファイバを切断するものである。ところでこの2つのIPCで検索するといずれも結果は0件となる。この結果はIPDLでも商用データベースでも同じ結果となる。さて、それでは一方FIで検索すればどうなるであろうか。実は、図2に示すようにこのIPCに対応するFIは存在し、それぞれG02B6/00,333およびG02B6/00,334となっている。

・6/24 (2006.01) ・ライトガイドのための結合(電氣的導波管用H01P1/00) [4, 5]	CC
・6/245 (2006.01) ・結合の前処理としてライトガイドの保護被覆を除去するもの[5]	
・6/25 (2006.01) ・結合のためにライトガイド端部を処理するもの, 例. 切断[5]	
・6/255 (2006.01) ・ライトガイドの永久結合, 例. 融着または接着[5]	CC

図1 IPC第8版 G02B6/00の一部 (PMGSより)

・6/00 ライトガイド	2H038 CC HB
A ファイバの測定[帯域, 屈折率, 減衰等]に関連するもの	2H038 CC HB
B 計測, 検知に適用したもの	2H038 CC HB
C 光通信用	2H038 CC HB
D 表示用	2H038 CC HB
E 制御, 変調	2H038 CC HB
Z その他のもの	2H038 CC HB
301 ・導光のための構造	2H038 CC HB
306 ・フィルタ	2H038 CC HB
311 ・減衰器	2H038 CC HB
316 ・アイソレータ	2H038 CC HB
321 ・光遅延素子	2H038 CC HB
326 ・光ラジエータ	2H038 CC HB
331 ・照明	2H038 CC HB
333 ・被覆除去	2H038 CC HB
334 ・切断によるもの	2H038 CC HB
335 ・研削加工によるもの	2H038 CC HB

図2 対応するFI (PMGSより)



これらのFIにて試みにIPDLの公報テキスト検索にて公開に限定して検索すると、それぞれ387件および252件がヒットする。これらは少なくとも同じ内容のIPCであるG02B6/245、G02B6/25で検索しても同じ結果となって欲しい。さて、それでは何故このようなことが生じたのか考えてみよう。図2の右側にあるCCであるが、これはFIから最新のIPCへのコンコードランスを表している。被覆除去、切断ともにコンコードランスするとG02B6/00となり、G02B6/245、G02B6/25とはならない。公報へのIPCの付与は、まずFIを付与してコンコードランスにて付与されると聞いている。これはFIがIPCの細分化されたものであって、必ずFIの方がIPCよりも細かい分類であるということが前提となっている。ところでFIは、IPC第4版をベースに作られたが、図1を見ると問題のG02B6/245およびG02B6/25はIPC第5版から新たにできたものである。FIは、IPCの改正に伴って適宜見直されていると聞いていたが、どうも必ずしも全てが新しいIPCに対応している訳ではないようである。このようなIPCが実際にはどのくらいあるのかは検討が必要であるが、少なくとも1件も付与されていないIPC、すなわち検索しても0件となるIPCは、調べたところ約2800件あった。これまで分類検索ではIPCよりもFIを推奨してきたが、この理由としてFIはIPCを日本の実状にあわせて細分化したものであるからと言ってきたが、今後はIPCでは漏れるからと説明を変えざるを得ないであろう。分類はその内容を良く把握して適切な分類を用いて検索する事が、使用する側に求められるが、このことは分類が適切に付与されている事が前提となる。分類の付与を確実にする事は基本の基本と思われる。早急に見直しを行って欲しいものである。

3.2 サーチャーの人材育成

最近、知財の人材育成ということがよく言われるが、サーチャーの人材育成はどのようなだろうか。昨年4月

に出された知財戦略事例集の最後に付録として、企業における特許情報の活用と題してアンケート結果のまとめが掲載されている。この中で興味深いのは「特許情報の活用に関する将来像（理想像）」において発明者自らが先行技術調査・分析を行い、特許情報を活用できるようにするという回答が圧倒的に多かった点である。確かにエンドユーザが検索できる環境が整ってきているのは事実である。データベースも全体的には検索が高機能化すると同時に低価格化がはかられ、またその一方自然語で検索できる全文検索や概念検索が出てきた事によって、エンドユーザを感じる検索の敷居が低くなってきているのかもしれない。またエンドユーザでも充分サーチが出来るようになって欲しいという将来への希望がこのアンケート結果なのかもしれない。しかしながら、全文検索の難しさや概念検索の現状については、よく理解した上で使用させる事が必要であり、エンドユーザサーチを導入した場合の教育や講習をどうすべきか、きちんと計画を立てて実行することは非常に重要である。また調査専門の所謂サーチャーに対する教育をどのようにすべきかということは、もっと重要であると考えている。現在、知的財産協会による一連の情報関連研修や（独）工業所有権情報・研修館が行っている検索エキスパート研修[上級]等があるのでこれらが大いに利用していただきたいが、このようなことを言うのも最近、基本ができていないサーチャーが多いように感じるからである。

4 おわりに

「知的財産戦略大綱」に述べられているように、知的創造サイクルを早く大きく回すために、企業活動の各段階で、それぞれの段階に応じた特許情報がタイムリーに提供される必要がある。このように知的創造サイクルを

回すのに役立つ特許情報こそが、価値ある特許情報といえる。また2章で述べたように、審査官のサーチツールが今後、無償で提供される等により民間の商用データベースは、今以上に高機能化やあるいは分析・解析機能が付加されていくであろう。情報を扱う人は、これらの新機能や解析機能等を使うことによって、本当に価値ある特許情報が得られるのかを確認し、使いこなす必要がある。また解析ツールを使いこなして何らかの結果が得られたとしても、最終的にその結果をどう読み取るか判断するのは結局人間であり、読み取り判断する能力を養う必要がある。またこのようにツールを使いこなす判断ができる人材を育成することも必要である。このように今後、特許情報を扱う人は単にサーチするだけでなく、人材育成にも力を注ぎ、その一方で、特許情報を元にした高度な解析を行える実力を養う必要があろう。

参考文献

- (1) 特許庁業務・システム最適化計画（改訂版）
http://www.jpo.go.jp/torikumi/system/system_optimize_re.htm
- (2) 知的財産推進計画2008
<http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/2008keikaku.pdf>
- (3) イノベーションと知財政策に関する研究会政策提言
および報告書
http://www.jpo.go.jp/torikumi/puresu/press_tizai_system_koutiku.htm
- (4) 特許庁業務・システム最適化計画（検索系システム
追補版）（案）
http://www.jpo.go.jp/iken/pdf/iken_systemsaitekika/iken_systemsaitekik.pdf

